(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顯公開番号

特開平5-301228

(43)公開日 平成5年(1993)11月16日

(51)Int.Cl. ⁵ B 2 9 C 33/62 C 0 8 K 5/00 5/521 C 0 8 L 71/02 C 1 0 M 173/02	識別記号 LQC	庁内整理番号 8927-4F 7242-4 J 7242-4 J 9167-4 J 9159-4H	F I - - - - - - - - - - - - -	技術表示箇所 技術表示箇所
(21)出願番号	特願平4-109566		(71)出願人	000002852
(21)山嶼番与	44644-103000		(ロ)正殿八	グイキン工業株式会社
(22)出顧日	平成 4年(1992) 4	月28日		大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号
				梅田センターピル
			(72)発明者	山名 雅之
				大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン
				工業株式会社淀川製作所内
			(72)発明者	山本 育男
				大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン
			(70) 7 % 00 ±2	工業株式会社淀川製作所内
			(72)発明者	藤原 伸吾 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン
				工業株式会社淀川製作所内
			(74)代理人	弁理士 青山 葆 (外1名)

(54)【発明の名称】 離型剤

(57)【要約】

【構成】 少なくとも1つの官能基を有する含ハロゲン ポリエーテルを主成分とすることを特徴とする水系の離 型剤。

【効果】 本発明の水系の離型剤は、環境汚染の問題が なく、分散性、保存安定性、離型性に優れかつ高分子物 質の成型品に良好な表面状態を与える。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの官能基を有する含ハロ ゲンポリエーテルを主成分とすることを特徴とする水系 の離型剤。

【請求項2】 a)少なくとも1つの官能基を有する含ハ ロゲンポリエーテル

、b)界面活性剤、および

c)水

を含んでなる請求項1に記載の水系の離型剤。

【請求項3】 含ハロゲンポリエーテルがパーフルオロ 10 ポリエーテルである請求項1または2に記載の水系の離 型剤。

【請求項4】 の炭素数4~20のパーフルオロアルキ ル基含有リン酸エステル若しくはその塩を更に含む請求 項2または3に記載の水系の離型剤。

【請求項5】 界面活性剤がノニオン系界面活性剤であ る請求項2~4のいずれかに記載の水系の離型剤。

【請求項6】 官能基がカルボン酸基若しくはその塩で ある請求項1~5のいずれかに記載の水系の離型剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、離型剤に関し、更に詳 しくは合成樹脂またはゴム等の髙分子物質の成形品製造 の際に使用される水系離型剤に関する。

[0002]

【従来の技術および課題】従来、含ハロゲンポリエーテ ルを主成分とする有機溶剤系の離型剤は知られている (特開昭61-112610号公報)。 しかし、 このよう な含ハロゲンポリエーテルを主成分とするものは離型性 が優れるものの、有機溶剤系であるため使用の際に環境 30 オロポリエーテルが好ましい。好ましい含ハロゲンポリ 汚染の問題がある。そとで、環境汚染の問題のない含ハ ロゲンポリエーテルを主成分とする水系の離型剤が要望*

*されるが、特開昭61-112610号公報に記載され ている含ハロゲンポリエーテルを主成分とする水系の離 型剤は保存安定性に劣る(即ち、含ハロゲンポリエーテ ルが分離する。)という問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、使用 の際に環境汚染の問題がなく、分散性、保存安定性、離 型性に優れかつ高分子物質の成型品に良好な表面状態を 与える水系の離型剤を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、少なく とも1つの官能基を有する含ハロゲンポリエーテルを主 成分とすることを特徴とする水系の離型剤に存する。

【0005】本発明の離型剤は、

a)少なくとも1つの官能基を有する含ハロゲンポリエー テル、

b)界面活性剤、および

c)水

を含んでなる。

20 【0006】本発明で用いられる含ハロゲンポリエーテ ルは、少なくとも1つの官能基を有していることが必要 であり、特開昭61-112610号公報に記載されて いるような官能基を有しないものは好ましくない。

【0007】官能基を有する含ハロゲンポリエーテル は、公知のものが使用でき、例えば、特開平1-131 132号公報、特開平3-134189号公報、特開平 1-268664号公報、特開平3-132917号公 報に記載されている。

【0008】少なくとも1つの官能基を有するパーフル エーテルの具体的には、

【化1】

$$F \leftarrow C F_2 C F_2 C F_2 O_{\overline{n}} - C F_2 C F_2 - R$$

$$F \leftarrow (C F C F_2 O)_n - C F - R,$$

$$| | | C F_3 C F_3$$

$$CF_3O - (CF_2CF_2O)_{\overline{m}} - (CF_2O)_{\overline{r}} - CF_2 - R$$

【化2】

等が例示される。

0である。]

【0009】カルボン酸基またはその塩を有するパーフ 性剤を使用した ルオロボリエーテルが金型表面への密着性の点で特に好 30 安定性が良い。 またい 【0012】本

【0010】含ハロゲンポリエーテルの平均分子量は、 1000~5000、特に1500~3500であることが好ましい。

【0011】本発明で使用される界面活性剤は、炭化水 素系、フッ素系のいずれであってもよく、例えばラピゾ ールB-80(日本油脂(株)製)、ノニオンNS230 (日本油脂(株)製)、ノニオンNS220(日本油脂(株) 製)、ユニダインDS403(ダイキン工業(株)製)が例 示される。中でも、ノニオン系の界面活性剤が保存安定*40

*性の点で好ましく、特にノニオン系の炭化水素系界面活性剤を使用した場合は透明(全く白濁なく)で著しく保存 安定性が良い。

【0012】本発明の水系の離型剤は、例えば、含ハロゲンポリーテル、界面活性剤および水を超音波ホモジナイザーを用いて乳化することによって調製することができる。

【0013】本発明の水系の離型剤は、更にの炭素数4~20のパーフルオロアルキル基含有リン酸エステル若しくはその塩を含んでよい。パーフルオロアルキル基含有リン酸エステルとしては、

【化3】

[式中、mは1~9、nは1、2または3である。]が【0014】この場合、安定性の面で、含ハロゲンポリ例示できる。50エーテルを乳化した後にパーフルオロアルキル基含有リ

5

ン酸エステルを混合することが好ましい。炭素数4~2 0のパーフルオロアルキル基含有リン酸エステルを含む ことにより、例えばウレタンに良好な離型性を与えるこ とができる。

【0015】本発明の水系の離型剤には、シリコーンまたはワックス系の化合物を混合して使用してもよい。シリコーン系またはワックス系の化合物を混合することにより更に表面状態が向上し、特にウレタンフォームのようにセル荒れを起こし易い場合、セル荒れを減少させることができる。

【0016】シリコーン系化合物としては、シリコーンオイル、シリコーンレジン、シリコーンオイルとレジンの混合物が例示でき、ワックス系化合物としては、パラフィン系ワックスを例示するととができる。

【0017】本発明の水系離型剤の各成分の混合割合は、

a)含ハロゲンポリエーテル1重量部に対して、

b)界面活性剤0.02~0.8重量部、好ましくは0.1 ~0.5重量部、

のパーフルオロアルキル基含有リン酸エステル若しくは 20 その塩の量は、含ハロゲンボリーテル1重量部に基づいて、0~1.0重量部、好ましくは0.1~0.8重量部、より好ましくは0.2~0.3重量部である。シリコーン系またはワックス系化合物の量は、含ハロゲンポリエーテル1重量部に基づいて、0~5.0重量部、好ましくは0~1.0重量部である。

【0018】本発明の水系の離型剤は、c)水以外の成分

6

を、通常0.1~20%、好ましくは0.5~10%含んでいれば良く、このように低濃度での使用が可能であり、離型剤の成形品への移行が少なく、成形品の後処理(塗装性、接着性)が容易である。

【0019】本発明の離型剤は、内部離型剤として用いてもよいが、外部離型剤として用いることが好ましい。本発明の離型剤を成形金型に塗布する際は、ハケ塗り、浸漬塗布、スプレー塗布などをあらゆる塗布方法を使用できる。本発明の離型剤は、合成樹脂およびゴム、特にポリウレタン、ポリウレアからなる成形品の製造に有用である。

[0020]

【実施例】以下に実施例および比較例を示し、本発明を 具体的に説明する。

【0021】実施例1~11および比較例1~4 第1表に示す成分を超音波ホモジナイザー(超音波工業 (株)、出力300W)で25℃で6分間乳化して、離型 剤を調製した。

【0022】次に、型に離型剤を塗布し、第2表に示す A液およびB液からウレタンフォームを成型した。離型性および成形品の表面状態を評価をした。離型応力(q/cm²)は、オートグラフ(島津製作所製DCM-50M)を用いて測定した。結果を第3表に示す。第3表には、離型剤の安定性も示す。

[0023]

【表1】

#124	

	媒体		₩	•	•	*	•	*	*	*	*	*	*	*	11711/10	/tan/		¥			•	
	パーフルオロアルキル	含有小酸xxm	1	1	1	ı	l	1	1	ļ	1.5%	1	1.5%		l ——			1			l	
ホ 」 女	炭化水素系界面活性剤		0.10%	0.25%	0.50%	1.00%	1.50%	2.50%	1.00%	1.00%	1.00%	0.25%	"	1.00%								
£	炭化水		NS230	:	*	*	`	*	*.	*	•	DS-403	*	NS230	ı			1	-		ı	
	ŤIV.		5%	*	*	*	•	*		*	*	*	*	*	*			"	// 社製)		*	(
	含ハロゲンポリエーテル		HS7f7.£	*	*	*	ì	*	Ŧ* 4+4SP	j* 474P	Ŧ* 474SH	. "		j.444S-20			シリコーソエマルン	3.7SH7036	(東レ・ダウワーニング社製	9,922711/33	EM0001	(日本精的製)
			実施例1	2 ,	es ,	4 "	ຸ ວ	9 "	٠ /	∞ `	6 	, 10	, 11	比較例1	2 "		» «			Ψ ″		

[0024]

40 【化4】

10

注:

デムナムSH:ダイキン工業(株)製

 $F \leftarrow (CF_2CF_2CF_2O) - CF_2CF_2COH$ (nt, 20~22 cb3.)

デムナムSP: ダイキン工業(株)製

 $F \leftarrow (CF_2CF_2CF_2O) - CF_2CF_2COCH_2CH_2O \rightarrow (nit, 20 \sim 22753)$

デムナムP:ダイキン工業(株)製

 $\{F + (CF_2CF_2CF_2O)_m + CF_2CF_2CH_2O\}_n + P(OH)_{3-n}$ $\{m \nmid 20 \sim 22, n \mid 11, 2, 3 \mid 755\}$

デムナムS-20:ダイキン工業(株)製

 $F \leftarrow CF_2CF_2CF_2O \rightarrow_{n} CF_2CF_3$ (ntl. 16 cb3)

[0025]

DS-403:ユニダインDS-403、ダイキン工業(株)製 CF(CF₂CF₂)_nCH₂CHCH₂O(CH₂CH₂O)₀H CF₃ ОН

(nは1~9である)

NS-230:日本油脂(株)製

 C_9H_{19} \longrightarrow $O(CH_2CH_2O)_{\overline{n}}$ \longrightarrow (n = 30 cas)

[0026]

* *【表2】

	サンニックスFA-912	ポリオール	100	重量部	三洋化成(株)製
A液	エチレングリコール	架橋剤	9	"	. "
	フロン11೮	発泡剤	1 5	"	"
	DABCO33LV	触媒	4	"	"
B液	コロネート1040	イソシア	6 5	"	日本ポリウレタ
		ネート			ン(株)製

30

【0027】·成形条件

金型材質

アルミニウム

金型形状

 $5.5 \,\mathrm{cm} \phi \times 1.0 \,\mathrm{cm}$

攪拌時間

5000rpm×10秒

発泡硬化時間

10分

金型温度

40℃

離型剤塗布方法 常温で刷毛塗り

[0028]

【表3】

13 第 3 表

		安定性	離型性	表面状態
			(g/cm²)	
実施例	1	0	160	良好
"	2	0	170	"
" ;	3	0	95	"
" "	4	0	110	"
"	5	0	125	"
" (6	0	150	"
" '	7	0	150	"
/ " 8	8	0	230	"
/ " (9	0	100	"
"	10	0	150	"
"	11	0	160	"
比較例:	1	×	190	"
" 2	2	0	230	ピンホールが
İ				生じる
" 3	3	0	300	良好
" (4	0	350	良好

* [0029]

【発明の効果】本発明の水系の離型剤は、環境汚染の問題がなく、分散性、保存安定性、離型性に優れかつ高分子物質の成型品に良好な表面状態を与える。又、本発明の水系の離型剤は、官能基を水中側に持つ逆ミセルを形成し、金型表面に選択的に吸着し易く、より耐久性のある強固な被膜が形成できる。また、有機溶剤系の離型剤に比し、被膜厚分布を均一に形成することができる。

14

10

注)

安定性:

◎:透明(2週間後も分離せず)

〇:乳白色(1週間後分離)

×:乳白色(2日後分離)

表面状態:

良好:セル荒れなし

*

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
//(C 1 0 M 173/02	!			
107:38	3			
137:04	!			
147:04	•			
153:04	ŀ			
145:26	5)			
B29K 71:00)			
C10N 30:06	;	8217 – 4H		
40:36	,			